



JASPA
JAPAN AEROSPACE PARTS ASSOCIATION



非破壊検査に関するご案内

JASPA 株式会社

<https://www.jaspa.co.jp>
info@jaspa.co.jp

共同工場運営による航空機部品一貫生産

弊社では 2017 年 1 月に、国際航空宇宙産業特殊工程認証プログラム（Nadcap）の蛍光浸透探傷検査の認証を取得し、共同工場における航空機部品の一括受注製造だけでなく、非破壊検査を含めた一貫生産体制を確立しました。

非破壊検査概要



◎取得認定

特殊工程名称	設備番号	検定、認可 適用スペック番号	検定、認定の種類 (タイプ・クラス等)	検定、認定 機関
蛍光浸透探傷検査	MaⅢ(D) MaⅢ(B)	AC7114 AC7114/1	Nadcap	PRI
蛍光浸透探傷検査	MaⅢ(D) MaⅢ(B)	ASTM E1417 NAS410	Type1 MethodD Level3 Type1 MethodD Level4	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光浸透探傷検査	MaⅢ(D) MaⅢ(B) システム認定	J-ISAJT-A002	GRADE 3 検査員認定システムを含む PW1100G-JM 部品限定	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光浸透探傷検査	MaⅢ(D) MaⅢ(B)	KT-8002 KQ-2501(PT)	Type1 MethodD Level3	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光浸透探傷検査	システム認定	ASTM E1417 NAS410	ASTM E1417/E1417M: 感度レベル 2 もしくは 3 NAS410 : レベル 2,3	株式会社 JAMCO
磁粉探傷検査	U20A-6KD0B 3Z176	KT-8001 KQ-2501(MT)	-	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI

◎検査員

特殊工程名称	作業レベル	検査員数	認証規格	認定機関
蛍光浸透探傷検査	レベル 3 KHI supplier Level 3	2 名	NAS410 J-ISAJT-A002 KQ-2501	JASPA(株) NANDTB KHI
蛍光浸透探傷検査	レベル 2	4 名	NAS410 J-ISAJT-A002 KQ-2501	JASPA(株)
磁粉探傷検査	レベル 3 KHI supplier Level 3	1 名	NAS410 KQ-2501	JASPA(株) NANDTB KHI
磁粉探傷検査	レベル 2	1 名	NAS410 KQ-2501	JASPA(株)

◎設備概要



<浸透探傷検査設備>

- ・ MAⅢ(A) Aライン Type1 メソッド A レベル 2,3 Form a
- ・ MAⅢ(D) Dライン Type1 メソッド A,D レベル 2,3, 4 Form a
- ・ MAⅢ(B) Bライン Type1 メソッド A,D レベル 2,3, 4 Form a

<洗浄設備>

- ・ アルカリ/酸洗浄装置

<磁粉探傷検査設備>

- ・ U20A-6KD0B 3Z176

MAⅢ(D) Dライン マークテック製

処理可能寸法：1200(L)×1200(W)×550(H)mm 処理可能重量：約 100kg

	<p>＜浸透ブース＞</p> <p>固定式ブラックライト</p> <p>浸透液</p> <p>ターンテーブル</p> <p>適用方法</p> <p>スーパーグロー蛍光浸透液</p> <p>Φ1400mm</p> <p>浸漬法、スプレー法、刷毛塗法</p>
	<p>＜前洗浄ブース＞</p> <p>固定式ブラックライト</p> <p>ターンテーブル</p> <p>洗浄ガン</p> <p>洗浄水除去用エアブロー</p> <p>Φ1400mm</p> <p>洗浄水圧力：0.150－0.270MPa</p> <p>エアブロー圧力：0.150－0.170 MPa</p>
	<p>＜本洗浄ブース＞</p> <p>ターンテーブル</p> <p>洗浄ガン</p> <p>洗浄水除去用エアブロー</p> <p>Φ1400mm</p> <p>洗浄水圧力：0.150－0.270MPa</p> <p>エアブロー圧力：0.150－0.170 MPa</p>
	<p>＜乳化槽＞</p> <p>室内寸法</p> <p>昇降リフターにて槽内浸漬をし、乳化剤を塗布する</p> <p>1500(L)×1400(W)×600(D)mm</p>
	<p>＜乾燥装置＞</p> <p>熱風循環式</p> <p>室内寸法</p> <p>設定温度</p> <p>1500(L)×1500(W)×600(H)mm</p> <p>62℃</p>
	<p>＜現像装置＞</p> <p>室内寸法</p> <p>適用方法</p> <p>乾式現像剤</p> <p>現像時間</p> <p>現像剤除去エアブロー</p> <p>1500(L)×1500(W)×550(H)mm</p> <p>エアフライング法</p> <p>スーパーグロー現像剤 D700</p> <p>10－240 分</p> <p>エアブロー圧力 0.034MPa 以下</p>
	<p>＜検査室＞</p> <p>ターンテーブル</p> <p>固定式ブラックライト</p> <p>ハンドブラックライト</p> <p>Φ1400mm</p> <p>紫外線強度：1200－7000μW/cm²</p> <p>照度：20Lux 以下</p> <p>紫外線強度：1200－7000μW/cm²</p> <p>照度：20Lux 以下</p>

アルカリ洗浄装置

処理可能寸法：φ1254mm×800(H)mm

処理可能重量：約 200kg

表面状態：機械加工面



<第一アルカリ洗浄槽>

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm
 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 3040L
 使用溶液 スーパー・ビー300LF(SB300LF)
 設定温度範囲 20～70℃



<アルカリ回収槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 2640L
 使用溶液 再生水



<第二アルカリ洗浄槽>

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm
 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 3040L
 使用溶液 -
 設定温度範囲 20～70℃



<湯洗槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 2640L
 使用溶液 再生水
 設定温度範囲 20～80℃



<乾燥機>

乾燥内寸法 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm
 熱風循環式
 設定温度 常温～350℃

酸洗浄装置

処理可能寸法：φ1254mm×800(H)mm

処理可能重量：約 200kg

表面状態：機械加工面



< 酸洗浄槽 >

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm
 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 3040L
 設定温度範囲 20～34℃
 材質 SUS304 槽内面テフロンコーティング



< 酸回収槽 >

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 2640L
 使用溶液 再生水
 材質 SUS304 槽内面テフロンコーティング



< 酸水洗槽 >

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 2640L
 使用溶液 再生水



< 酸湯洗浄槽 >

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm
 内容量 2640L
 使用溶液 再生水
 設定温度範囲 20～80℃

設備詳細

MAⅢ(A) Aライン マークテック製

処理可能寸法：920(L)×920(W)×500(H)mm 処理可能重量：約 100kg

	<p><浸透槽・排液台></p> <p>浸透液 処理有効寸法 適用方法</p> <p>スーパーグロー蛍光浸透液 1000(L)×1100(W)×500(D)mm 浸漬法、刷毛塗法</p>
	<p><洗浄槽></p> <p>固定式ブラックライト 洗浄ガン 洗浄水除去用エアブロー</p> <p>洗浄水圧力：0.150－0.270MPa エアブロー圧力：0.150－0.170 MPa</p>
	<p><乾燥装置></p> <p>熱風循環式 室内寸法 設定温度</p> <p>1000(L)×1100(W)×700(H)mm 62℃</p>
	<p><現像装置></p> <p>室内寸法 適用方法 乾式現像剤 現像時間 現像剤除去エアブロー</p> <p>1000(L)×1100(W)×700(H)mm エアフライング法 スーパーグロー現像剤 D700 10－240 分 エアブロー圧力 0.034MPa 以下</p>
	<p><検査室></p> <p>ハンドブラックライト</p> <p>紫外線強度：1200－7000μW/cm² 照度：20Lux 以下</p>

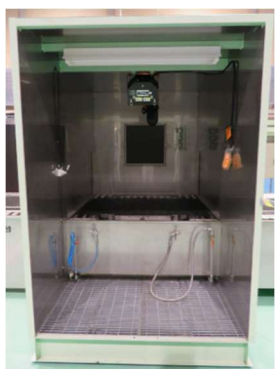
MAⅢ(B) Bライン マークテック製

処理可能寸法：1200(L)×1200(W)×550(H)mm 処理可能重量：約 100kg



＜浸透ブース＞
固定式ブラックライト
浸透液
ターンテーブル
適用方法

スーパードロー蛍光浸透液
Φ1400mm
浸漬法、スプレー法、刷毛塗法



＜洗浄ブース＞
固定式ブラックライト
ターンテーブル
洗浄ガン
洗浄水除去用エアブロー

Φ1400mm
洗浄水圧力：0.150－0.270MPa
エアブロー圧力：0.150－0.170 MPa



＜乾燥装置＞
熱風循環式
室内寸法
設定温度

1500(L)×1500(W)×600(H)mm
62℃



＜現像装置＞
室内寸法
適用方法
乾式現像剤
現像時間
現像剤除去エアブロー

1500(L)×1500(W)×550(H)mm
エアフライング法
スーパードロー現像剤 D700
10－240 分
エアブロー圧力 0.034MPa 以下

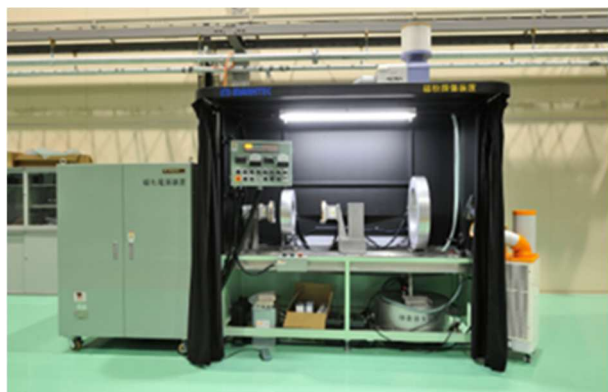


＜検査室＞
ターンテーブル
固定式ブラックライト
ハンドブラックライト

Φ1400mm
紫外線強度：1200－7000μW/cm²
照度：20Lux 以下
紫外線強度：1200－7000μW/cm²
照度：20Lux 以下

U20A-6KD0B 3Z176 磁粉探傷装置 マークテック製

処理可能寸法：φ400mm×1300(L)mm 処理可能重量：約 20kg



磁化方式	軸通電法、コイル法選択による 単一磁化
最大磁化電流	AC4000A(波高値)≒AC3000A(実効値) DC6000A(平均値 三相全波)
制御方式	無接点・無段階 SCR 位相制御方式

【参考】 その他保有設備



○X 線装置	
最大出力	450kV
X 線照射範囲	φ 1056 mm
X 線発生装置、X 線管、X 線照射室等から構成され、 外観から観察できない内部構造を観察するため、 X 線フィルムでの透視検査、解析が可能	



○立型サーフェスブローチ盤	
引抜力	160 kN
最大行程	2700mm
切削速度	0.5～20 m/min,50HZ
戻り速度	～20 m/min,50HZ
最大 NC 軸数	5
加工可能寸法	φ 800 mm



○ショットピーニングマシン	
処理目的	ピーニング
タイプ	回転テーブルおよびロボット式
処理可能寸法	最大: φ1300mm×280(H)mm 最小: φ680mm×67(H)mm
研削材	スチールショット NB#40(0.4mm)
ノズル脱着方式	オートチャージ式

会社概要

会 社 名 : JASPA 株式会社

設 立 : 2004 年 4 月 14 日

資 本 金 : 4,000 万円

所 在 地

(本社) 神奈川県横浜市中区真砂町 4-43 木下商事ビル 3 階

(営業本部) 神奈川県横浜市中区真砂町 4-43 木下商事ビル 3 階

(新潟工場) 新潟市西蒲区漆山字四十歩割 8460

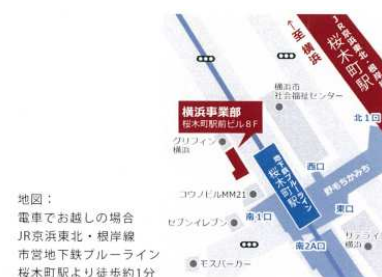
代 表 者 : 代表取締役／阿部 和幸

お問い合わせ先

営業本部 : 〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町 4-43
木下商事ビル 3 階

電話番号 : 045-264-4494 Fax 番号 : 045-264-4493

Mail: info@jaspa.co.jp URL: <https://www.jaspa.co.jp>



地図：
電車でお越しの場合
JR京浜東北・根岸線
市営地下鉄ブルーライン
桜木町駅より徒歩約1分

